

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年2月17日 (17.02.2005)

PCT

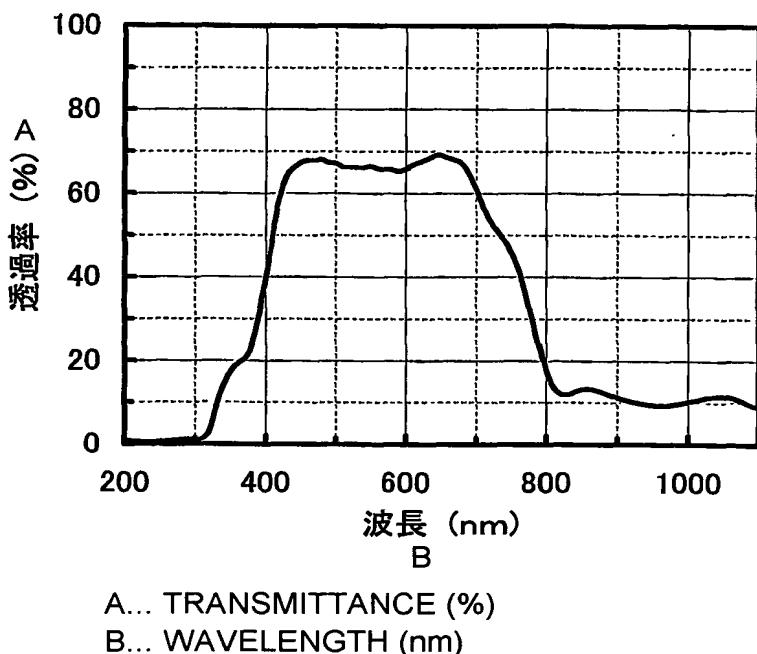
(10) 国際公開番号  
WO 2005/014270 A2

(51) 国際特許分類 <sup>7</sup> :	B32B	特願 2003-434290
(21) 国際出願番号:	PCT/JP2004/011788	2003年12月26日 (26.12.2003) JP 特願2004-180939 2004年6月18日 (18.06.2004) JP
(22) 国際出願日:	2004年8月11日 (11.08.2004)	(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋紡績株式会社 (TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒5300004 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 Osaka (JP).
(25) 国際出願の言語:	日本語	
(26) 国際公開の言語:	日本語	
(30) 優先権データ:		(72) 発明者: および
特願2003-291785 2003年8月11日 (11.08.2003) JP		(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 森 憲一 (MORI, Kenichi) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社 フィルム開発研究所 堅田フィルムセンター内 Shiga (JP). 吉見 晃 (YOSHIMI, Akira) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社 フィルム開発研究所 堅田フィ
特願2003-291787 2003年8月11日 (11.08.2003) JP		
特願 2003-432735 2003年12月26日 (26.12.2003) JP		
特願 2003-434288 2003年12月26日 (26.12.2003) JP		

[続葉有]

(54) Title: NEAR-INFRARED ABSORBING FILM, PROCESS FOR PRODUCING THE SAME, NEAR-INFRARED ABSORBING FILM ROLL, PROCESS FOR PRODUCING THE SAME AND NEAR-INFRARED ABSORBING FILTER

(54) 発明の名称: 近赤外線吸収フィルムおよびその製造方法、近赤外線吸収フィルムロールおよびその製造方法、並びに近赤外線吸収フィルター



(57) Abstract: A near-infrared absorbing film comprising a transparent substrate film and, superimposed thereon, a near-infrared absorbing layer of composition containing a resin and a near-infrared absorbing dye that has the maximum absorption at a wavelength of 800 to 1200 nm, characterized in that 0.01 to 2.0 mass% of surfactant of 2 to 12 HLB is contained in the composition. The thus provided near-infrared absorbing film has wide absorptive power in the near-infrared region, exhibiting high light transmittance in the visible light region, and exhibits less change of optical characteristics over time. Further, the thus provided near-infrared absorbing film is one excelling in coating film appearance that can meet recent-year requirements for high luminance of display as well as high fineness and high image quality in hi-vision broadcasting.

WO 2005/014270 A2

(57) 要約: 本発明の近赤外線吸収フィルムは、透明基材フィルム上に、波長 800 ~ 1200 nm に極大吸収を有する近赤外線吸収色素と樹脂を含有する組成物からなる近赤外線吸収層を設けた近赤外線吸収フィルムであって、前記組成物中にHLBが2~12の界面活性剤が0.01~2.0質量%含まれているところに特徴を有する。近赤外領域において幅広い吸収能を有し、可視光領域の光線透過率が高く、光学特性の経時変化が少なく、かつ、近年のディスプレイの高輝度化、ハイビジョン放送による高精細化や高画質化に対応し得る塗膜外観に優れた近赤外線吸収フィルムを提供することができる。



ルムセンター内 Shiga (JP). 尾道 晋哉 (ONOMICHI, Shinya) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社 フィルム開発研究所 堅田フィルムセンター内 Shiga (JP). 清水 敏之 (SHIMIZU, Toshiyuki) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社 フィルム開発研究所 堅田フィルムセンター内 Shiga (JP). 上坂 佐 (KOSAKA, Tasuku) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社 フィルム開発研究所 堅田フィルムセンター内 Shiga (JP). 多喜 博 (TAKI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社 フィルム開発研究所 堅田フィルムセンター内 Shiga (JP). 水野 直樹 (MIZUNO, Naoki) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社 フィルム開発研究所 堅田フィルムセンター内 Shiga (JP). 池畠 良知 (IKEHATA, Yoshitomo) [JP/JP]; 〒9140047 福井県敦賀市東洋町10番24号 東洋紡績株式会社 フィルム開発研究所 敦賀フィルムセンター内 Fukui (JP). 森重 地加男 (MORISHIGE, Chikao) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社 フィルム開発研究所 堅田フィルムセンター内 Shiga (JP).

(74) 代理人: 植木 久一, 外 (UEKI, Kyuichi et al.); 〒5300003 大阪府大阪市北区堂島2丁目1番16号 フジタ東洋紡ビル9階 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
 — 國際調査報告書なし; 報告書を受け取り次第公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。